

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】令和3年5月13日(2021.5.13)

【公開番号】特開2021-50208(P2021-50208A)

【公開日】令和3年4月1日(2021.4.1)

【年通号数】公開・登録公報2021-016

【出願番号】特願2020-195185(P2020-195185)

【国際特許分類】

C 0 7 C 229/12 (2006.01)
 A 6 1 K 31/18 (2006.01)
 A 6 1 K 31/198 (2006.01)
 A 6 1 K 31/275 (2006.01)
 A 6 1 K 31/41 (2006.01)
 A 6 1 P 3/10 (2006.01)
 A 6 1 P 21/00 (2006.01)
 A 6 1 P 25/00 (2006.01)
 A 6 1 P 25/08 (2006.01)
 A 6 1 P 35/00 (2006.01)
 A 6 1 P 37/02 (2006.01)
 A 6 1 P 43/00 (2006.01)
 C 0 7 C 229/20 (2006.01)
 C 0 7 C 233/46 (2006.01)
 C 0 7 C 233/83 (2006.01)
 C 0 7 C 311/14 (2006.01)
 C 0 7 C 309/24 (2006.01)
 C 0 7 C 237/06 (2006.01)
 C 0 7 C 233/63 (2006.01)
 C 0 7 C 311/19 (2006.01)
 C 0 7 C 235/76 (2006.01)
 C 0 7 C 311/05 (2006.01)
 C 0 7 C 261/04 (2006.01)
 C 0 7 C 229/32 (2006.01)
 C 0 7 F 7/10 (2006.01)
 C 0 7 C 229/22 (2006.01)

【 F I 】

C 0 7 C 229/12 C S P
 A 6 1 K 31/18
 A 6 1 K 31/198
 A 6 1 K 31/275
 A 6 1 K 31/41
 A 6 1 P 3/10
 A 6 1 P 21/00
 A 6 1 P 25/00
 A 6 1 P 25/08
 A 6 1 P 35/00
 A 6 1 P 37/02
 A 6 1 P 43/00 1 0 5
 A 6 1 P 43/00 1 1 1
 C 0 7 C 229/20

C 0 7 C 233/46
C 0 7 C 233/83
C 0 7 C 311/14
C 0 7 C 309/24
C 0 7 C 237/06
C 0 7 C 233/63
C 0 7 C 311/19
C 0 7 C 235/76
C 0 7 C 311/05
C 0 7 C 261/04
C 0 7 C 229/32
C 0 7 F 7/10 C
C 0 7 C 229/22

【手続補正書】

【提出日】令和3年3月15日(2021.3.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

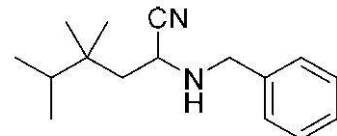
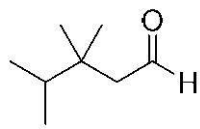
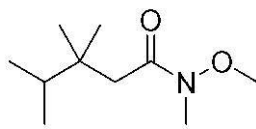
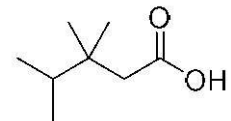
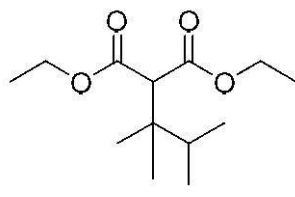
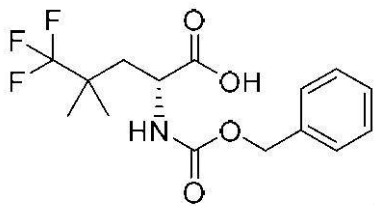
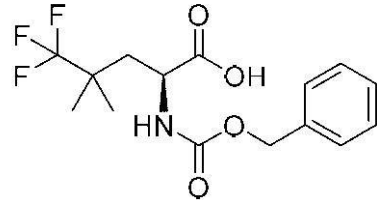
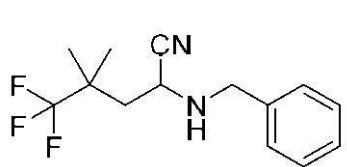
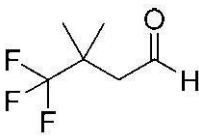
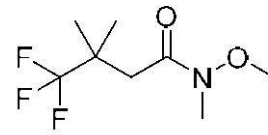
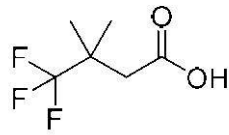
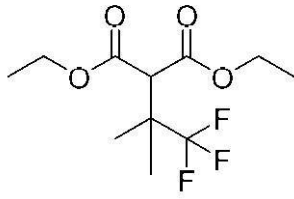
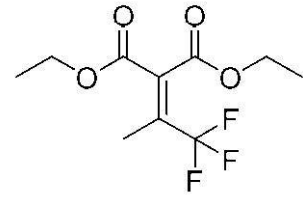
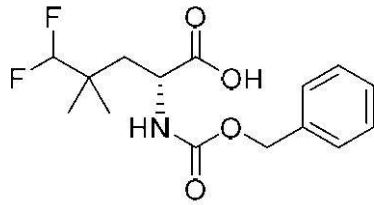
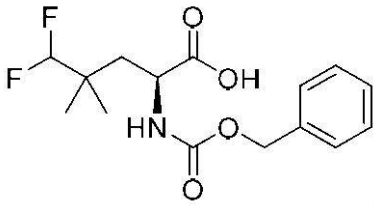
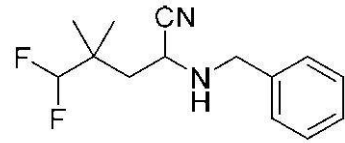
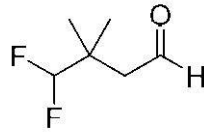
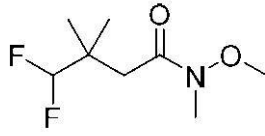
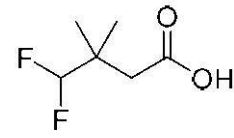
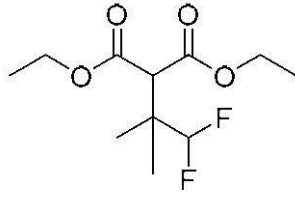
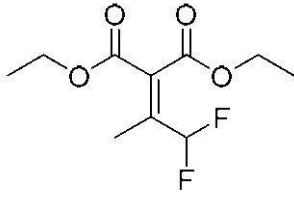
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

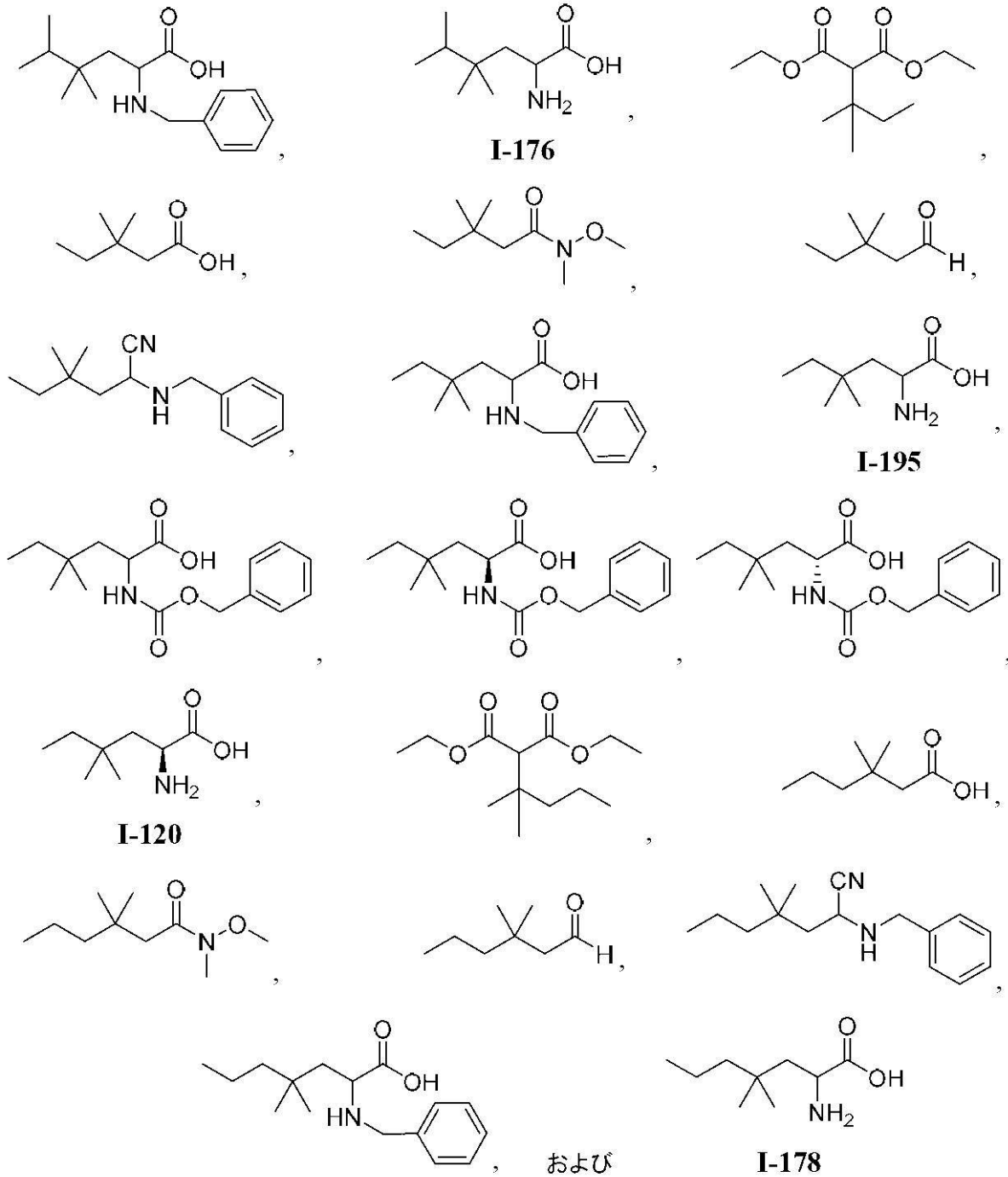
【請求項1】

以下：

【化 1 - 1】



【化 1 - 2】

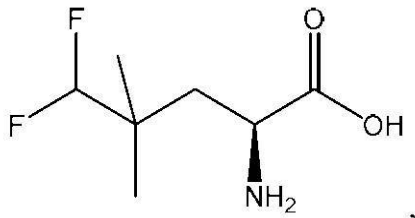


から選択される化合物。

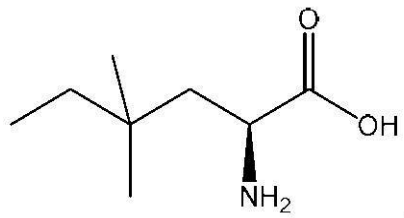
【請求項 2】

以下：

【化 2 - 1】

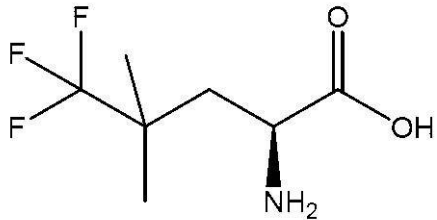


I-90

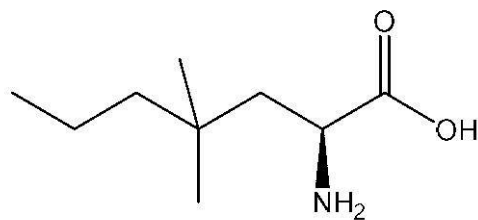


I-120

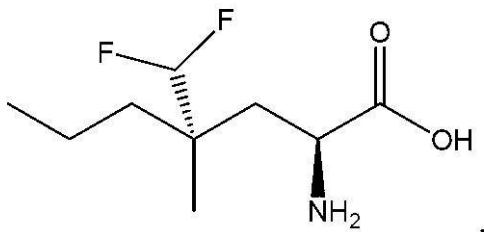
【化 2 - 2】



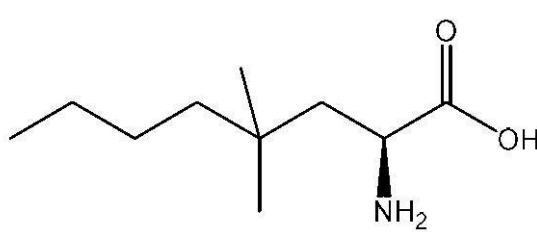
I-128



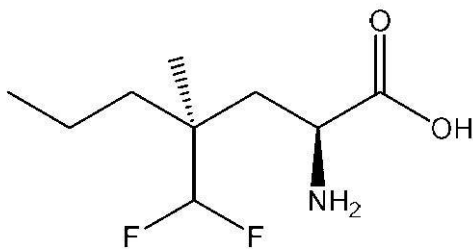
I-210



I-229

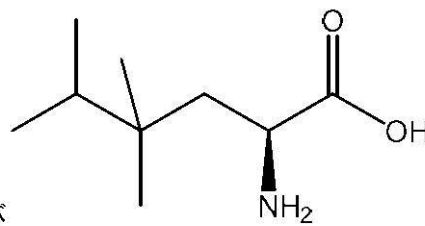


I-230



I-232

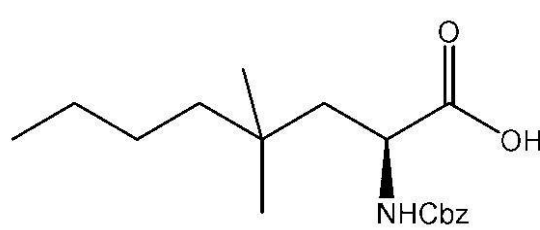
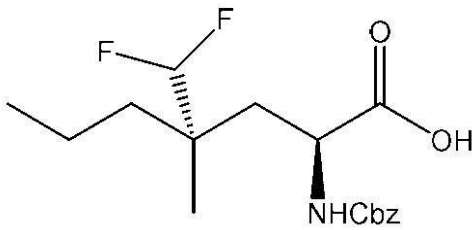
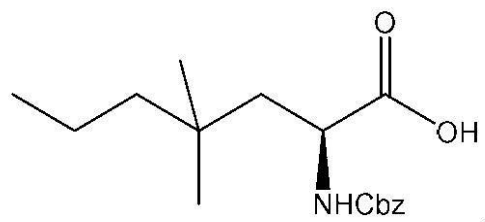
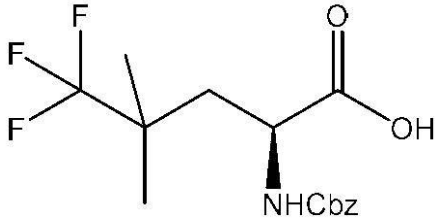
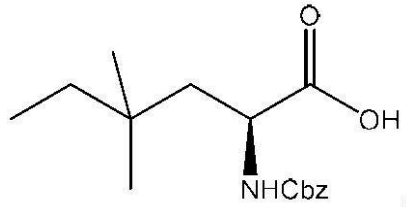
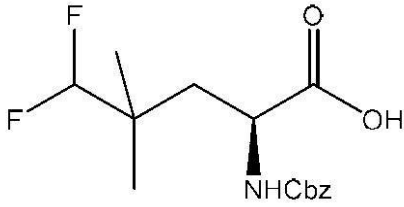
および



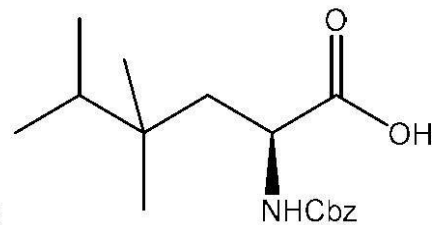
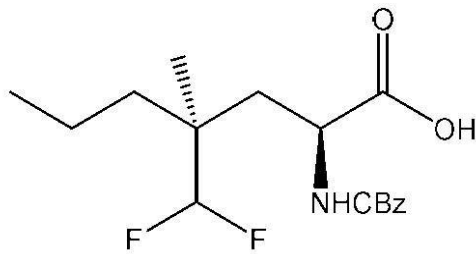
I-243

から選択される化合物を調製するためのプロセスであって、
以下：

【化 2 - 3】



【化 2 - 4】



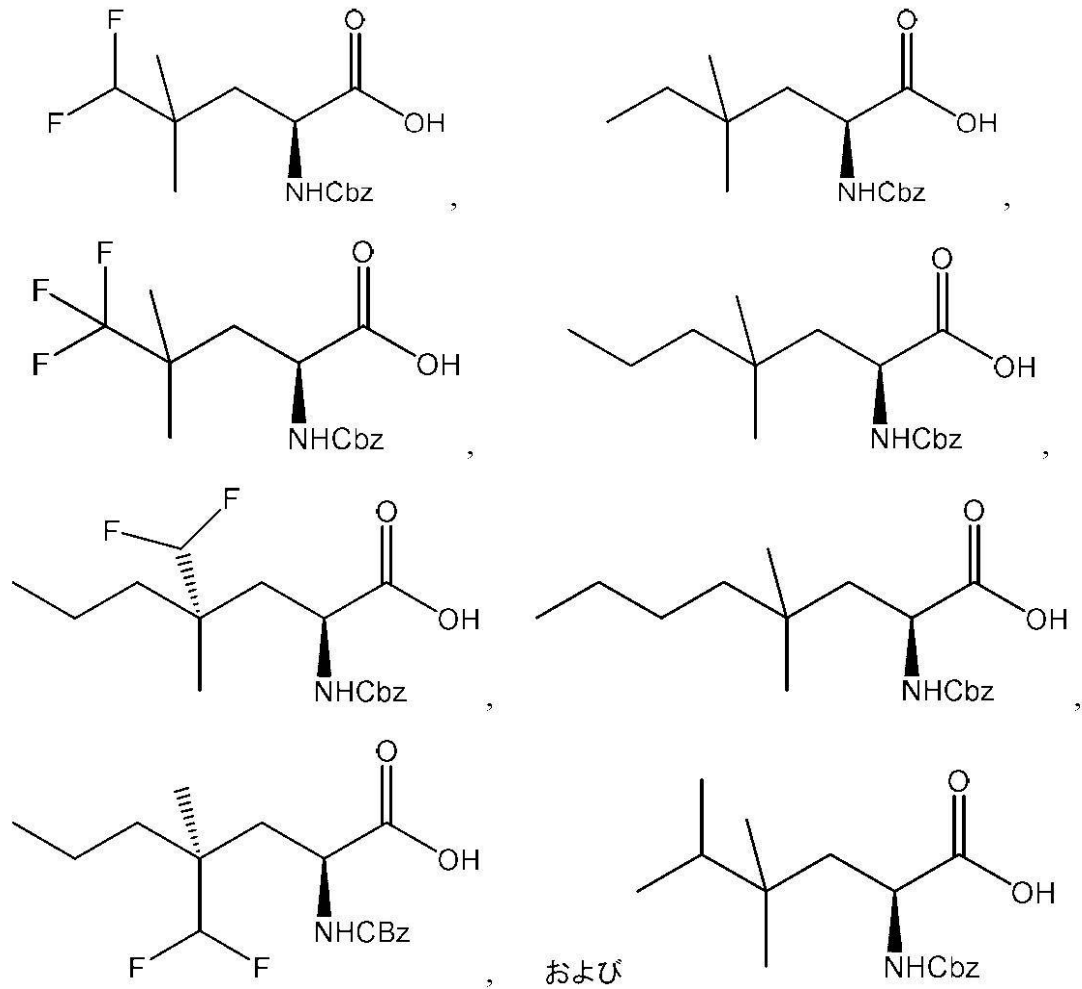
, および

から選択される化合物を、パラジウム炭素および水素ガスで、メタノール中で処置することを含む、
プロセス。

【請求項 3】

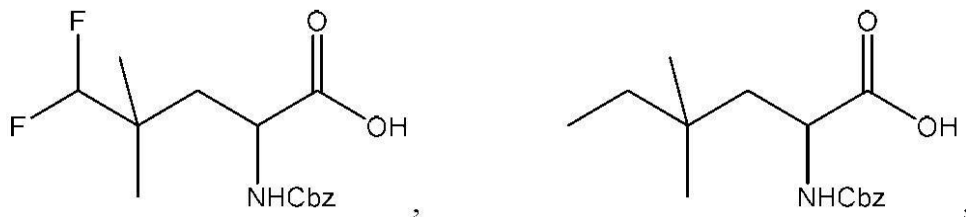
以下：

【化3 - 1】

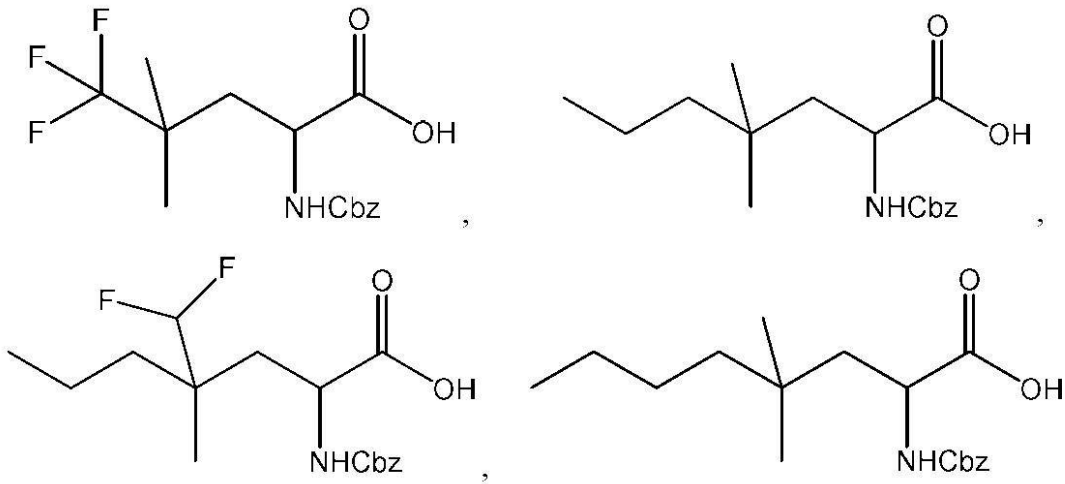


から選択される化合物を調製するための請求項2に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化3 - 2】

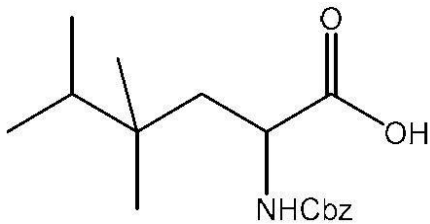


【化3-3】



および

【化3-4】



から選択される化合物に、キラルカラムを用いる逆相クロマトグラフィーを施すことを含

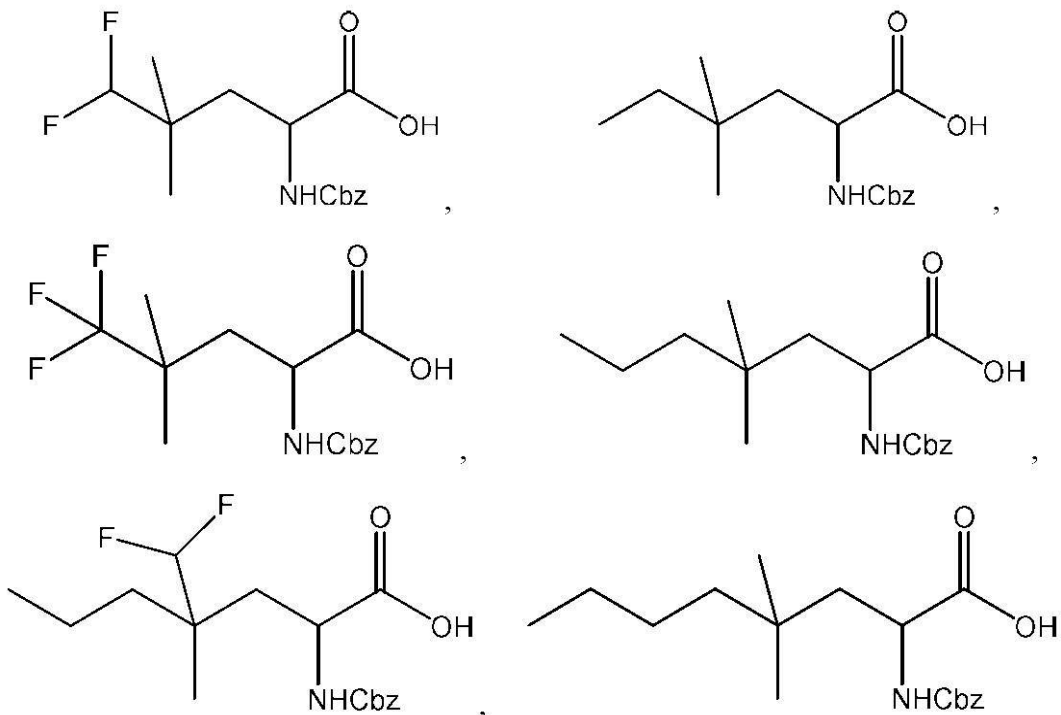
む、

プロセス。

【請求項4】

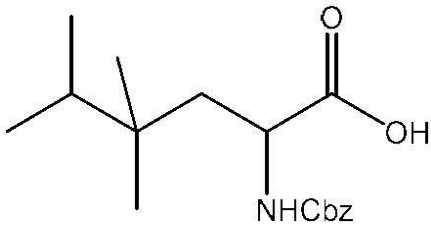
以下：

【化4-1】



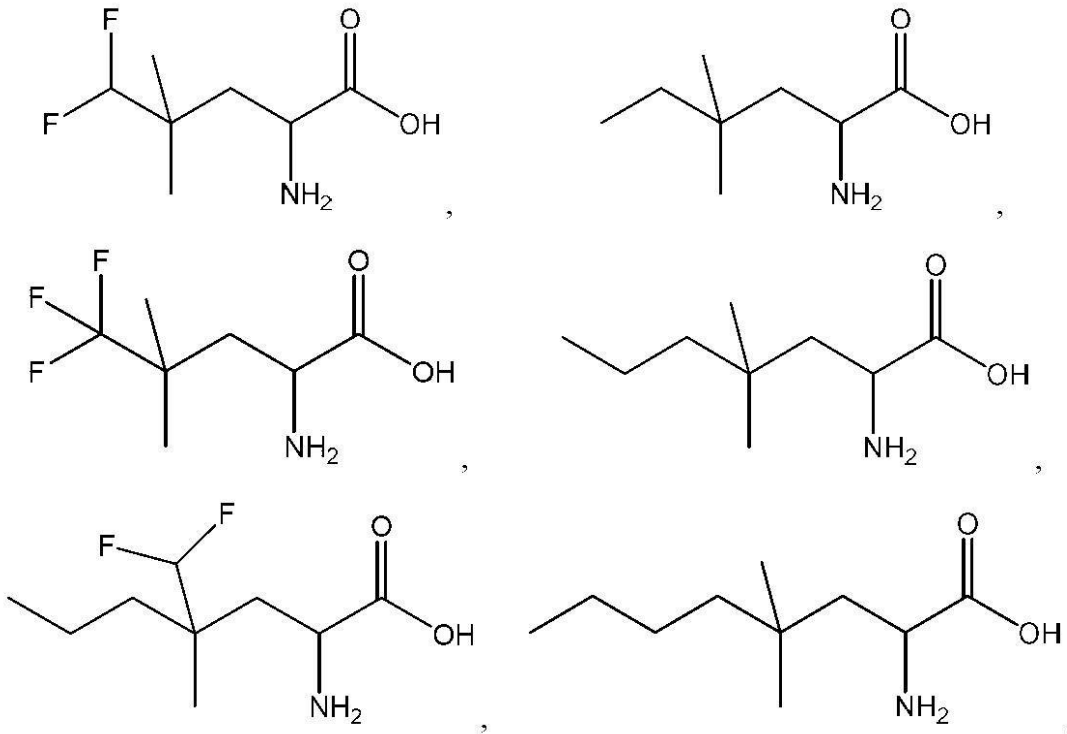
および

【化 4 - 2】



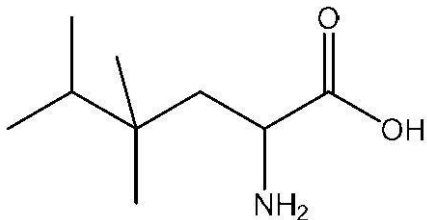
から選択される化合物を調製するための請求項 3 に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化 4 - 3】



および

【化 4 - 4】

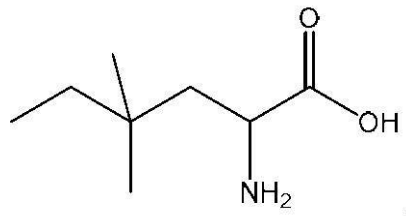
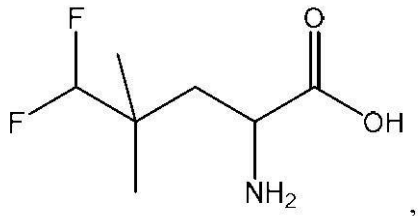


から選択される化合物を、ベンジル N - スクシンイミジルカーボネート (C b z - O S u)
および炭酸水素ナトリウムで、アセトン水溶液中で処置することを含む、
プロセス。

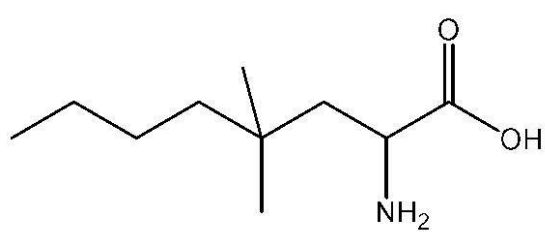
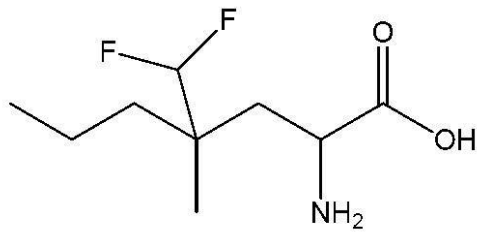
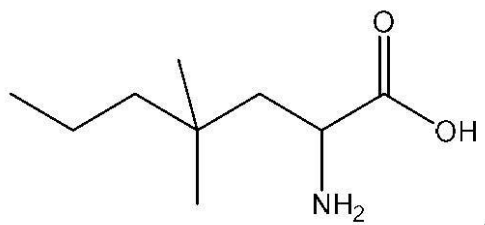
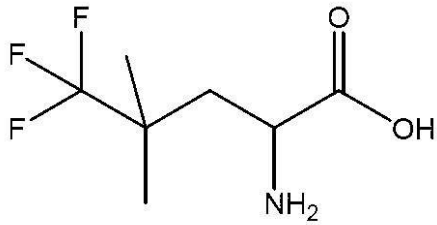
【請求項 5】

以下：

【化 5 - 1】

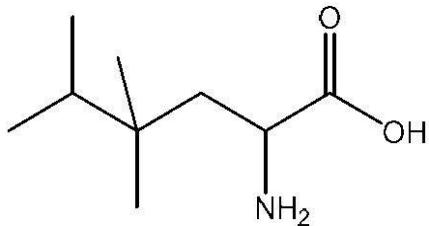


【化 5 - 2】



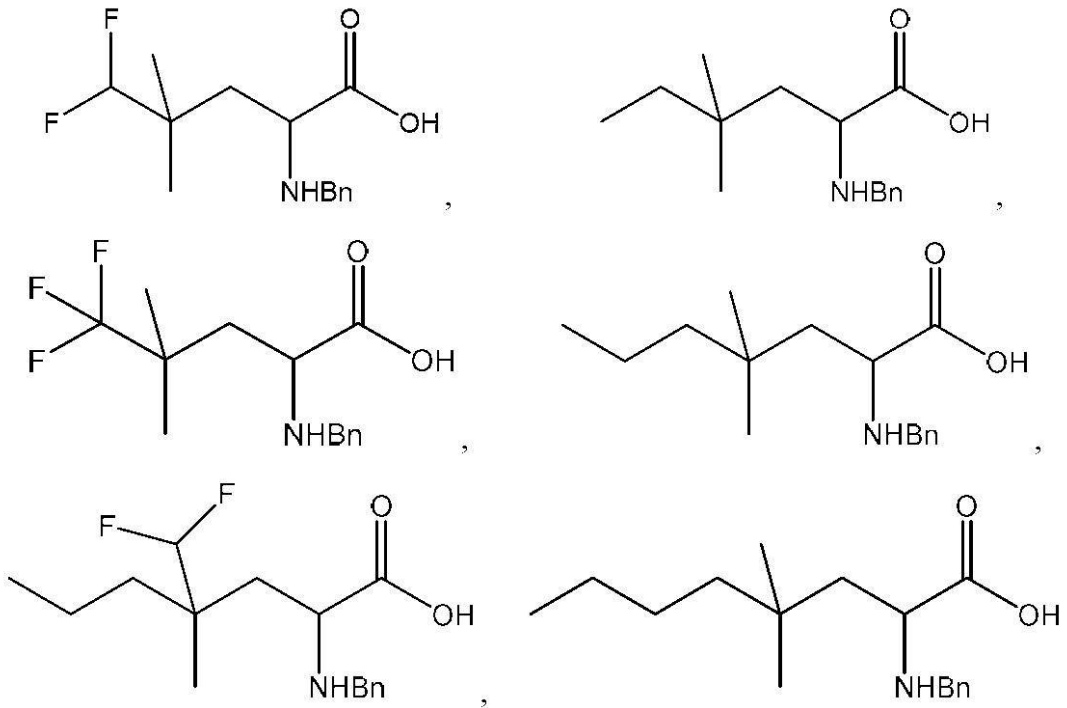
および

【化 5 - 3】



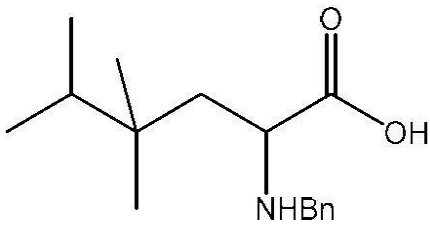
から選択される化合物を調製するための請求項 4 に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化5 - 4】



および

【化5 - 5】



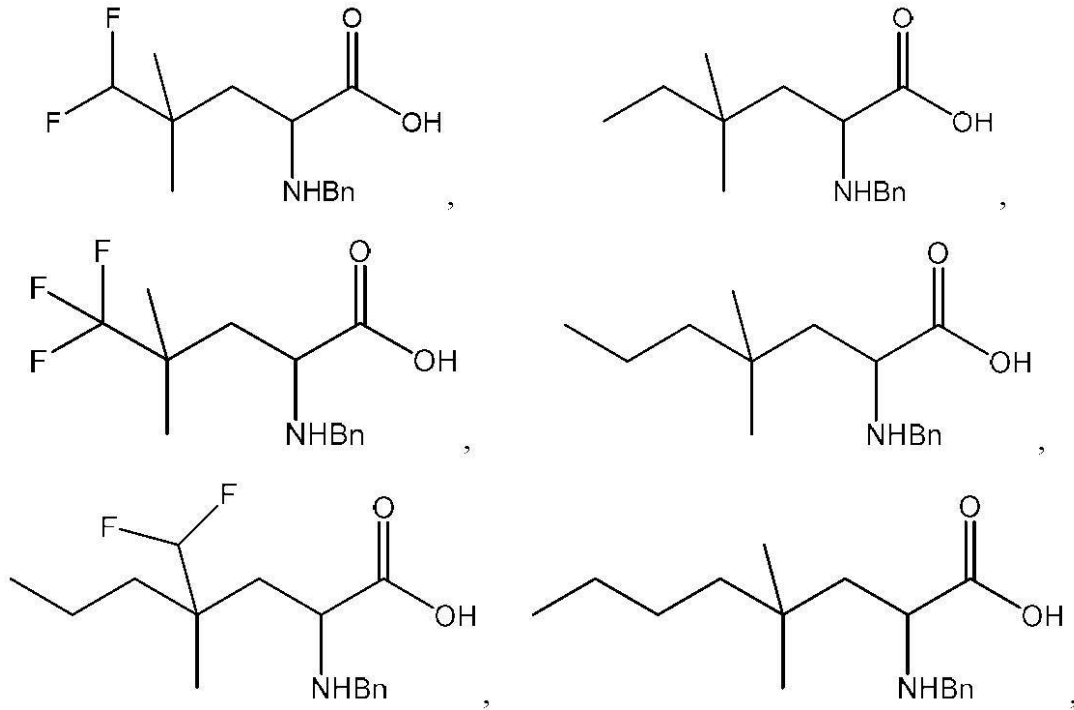
から選択される化合物を、パラジウム炭素およびギ酸アンモニウムで、メタノール中で処
置することを含む、

プロセス。

【請求項6】

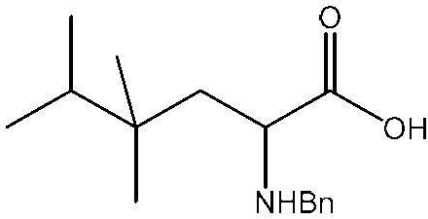
以下：

【化 6 - 1】



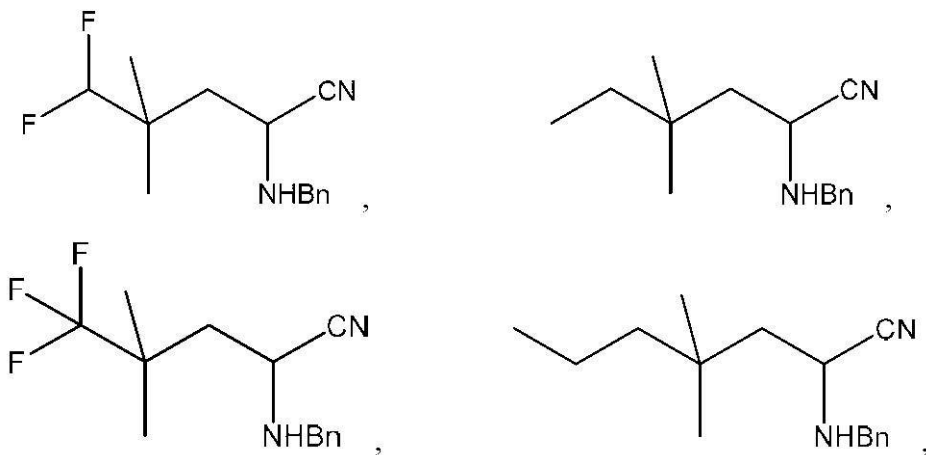
および

【化 6 - 2】

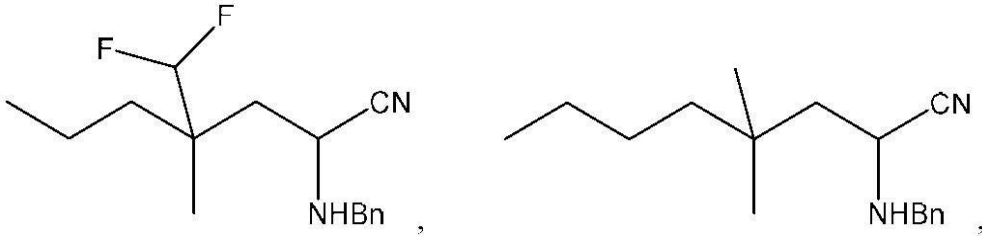


から選択される化合物を調製するための請求項 5 に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化 6 - 3】

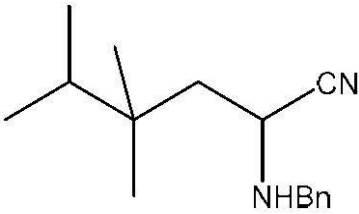


【化 6 - 4】



および

【化 6 - 5】

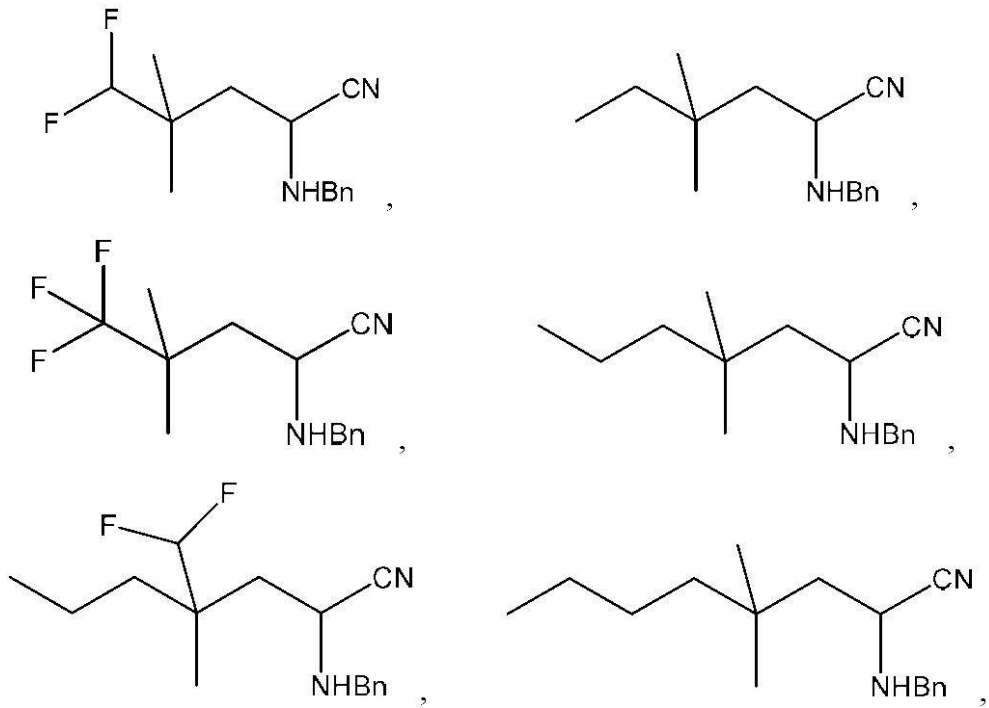


から選択される化合物を、塩化水素で、酢酸中で処置することを含む、プロセス。

【請求項 7】

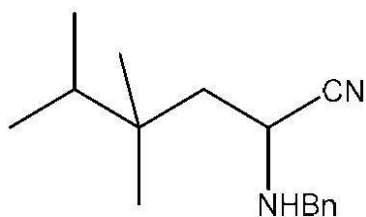
以下：

【化 7 - 1】



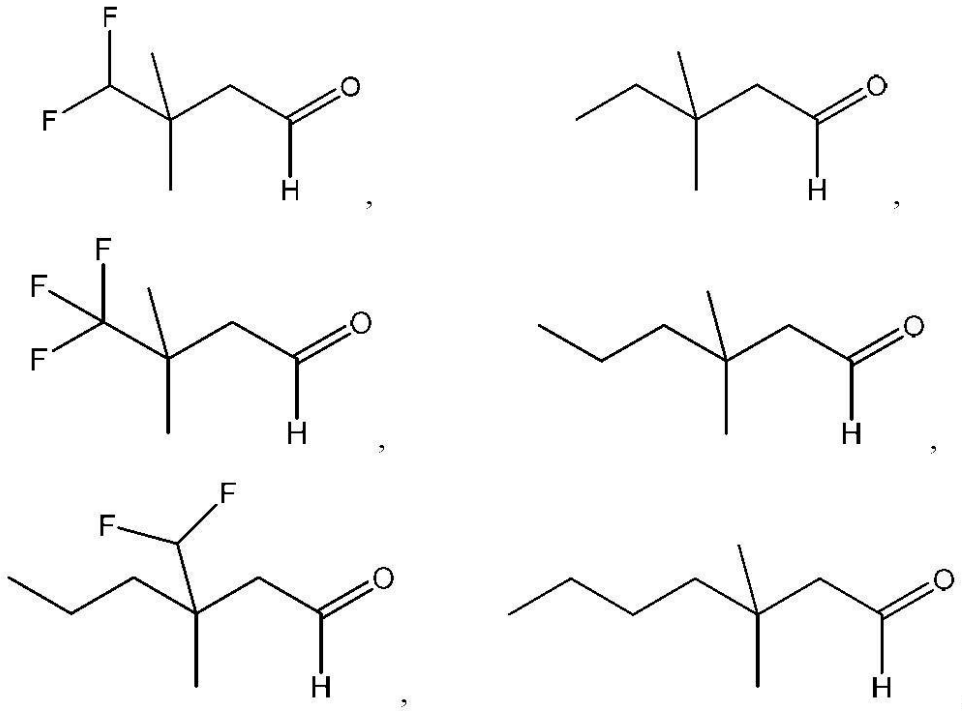
および

【化 7 - 2】



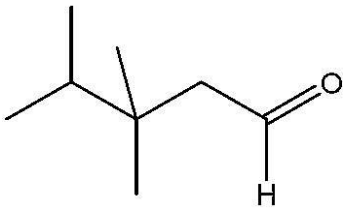
から選択される化合物を調製するための請求項 6 に記載のプロセスであって、前記プロセスは、以下：

【化7-3】



および

【化7-4】

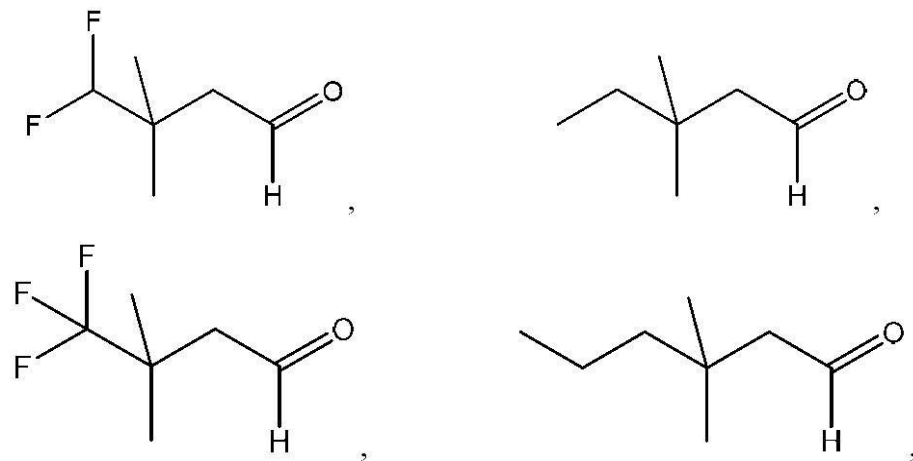


から選択される化合物を、ベンジルアミン、酢酸、およびシアン化トリメチルシリルで、ジエチルエーテル中で処置することを含む、プロセス。

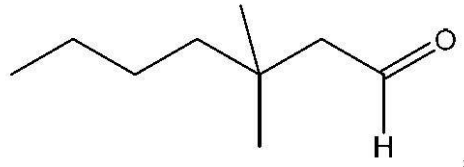
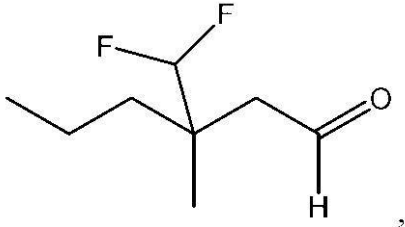
【請求項8】

以下：

【化8-1】

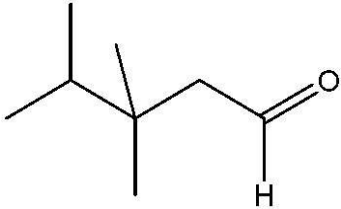


【化 8 - 2】



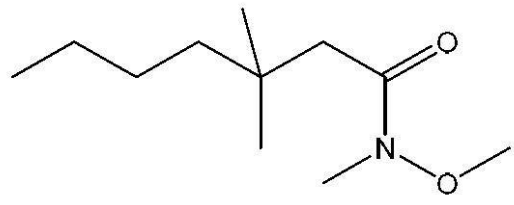
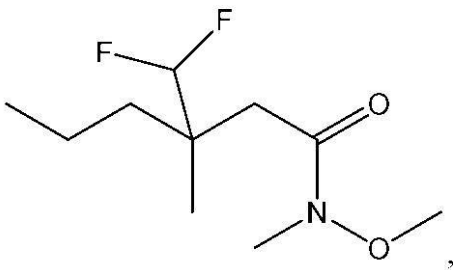
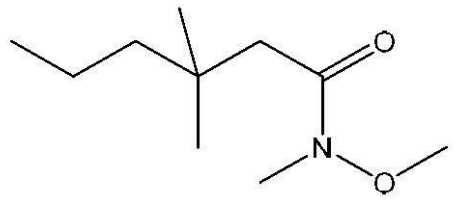
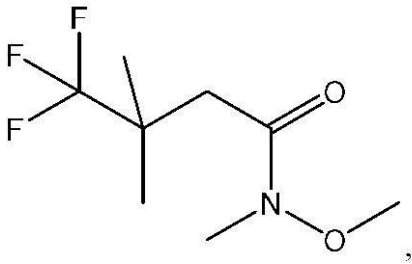
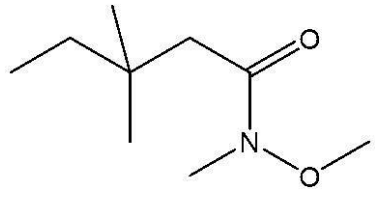
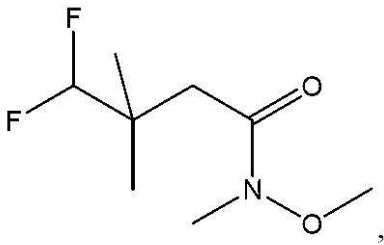
および

【化 8 - 3】



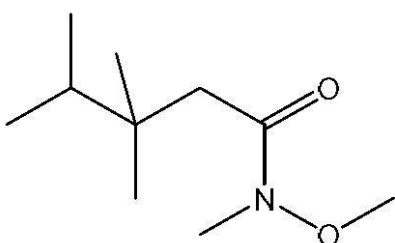
から選択される化合物を調製するための請求項 7 に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化 8 - 4】



および

【化 8 - 5】

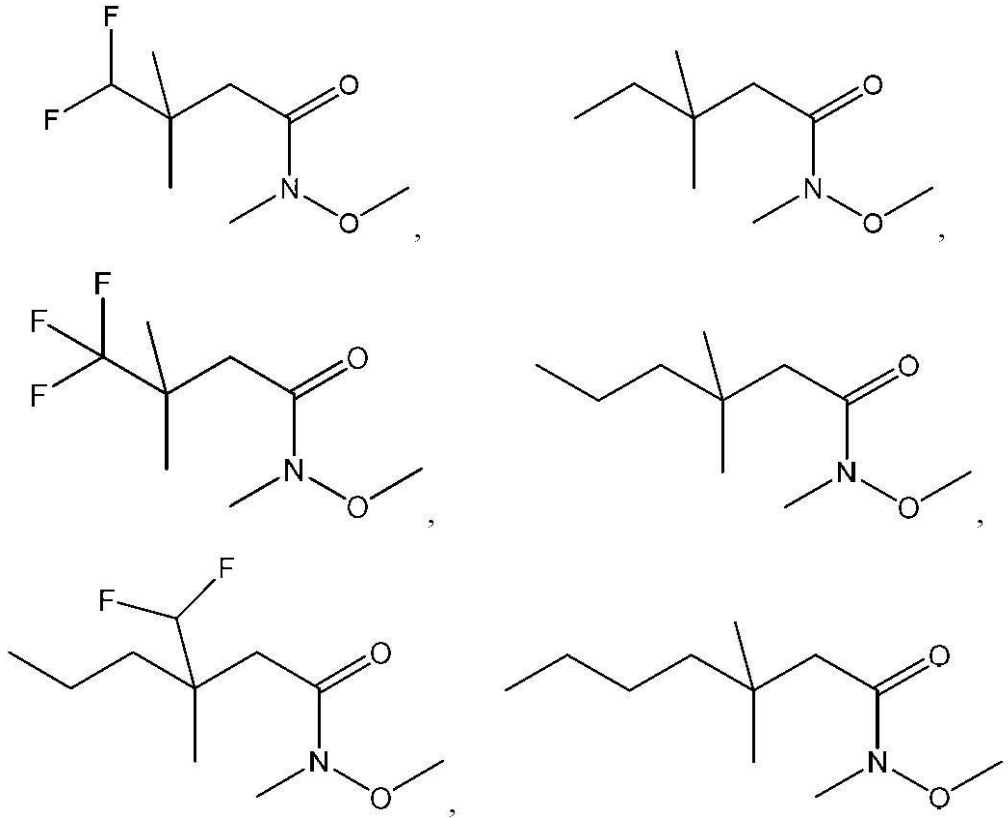


から選択される化合物を、水素化リチウムアルミニウムで、テトラヒドロフラン中で処置することを含む、
プロセス。

【請求項 9】

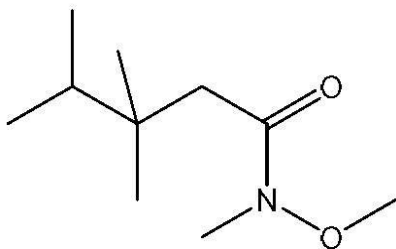
以下：

【化 9 - 1】



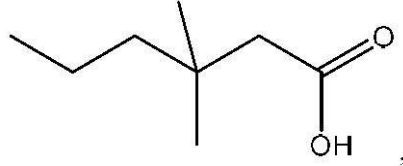
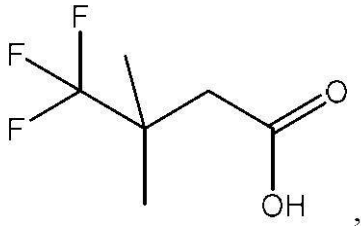
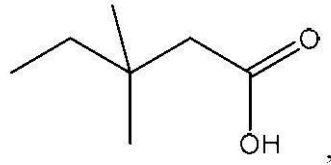
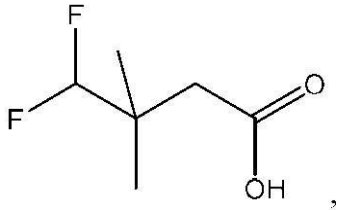
および

【化 9 - 2】

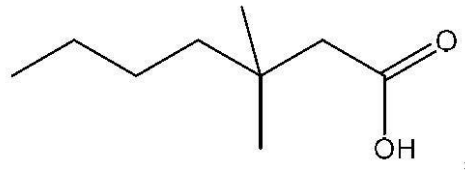
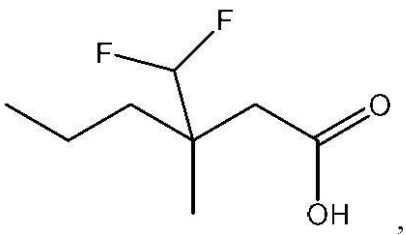


から選択される化合物を調製するための請求項 8 に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化 9 - 3】

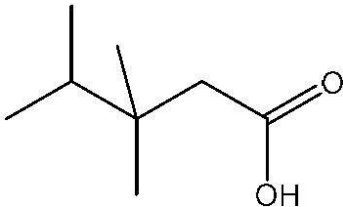


【化 9 - 4】



および

【化 9 - 5】



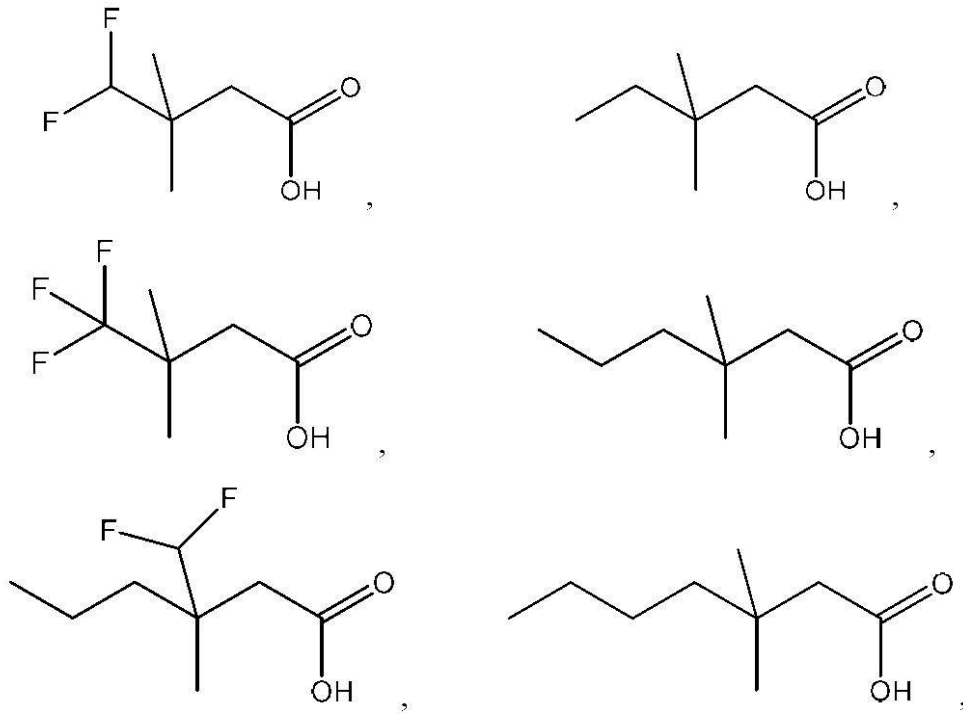
から選択される化合物を、(1 - [ビス(ジメチルアミノ)メチレン] - 1H - 1, 2, 3 - トリアゾロ[4, 5 - b]ピリジニウム3 - オキシドヘキサフルオロホスフェート (HATU)、トリエチルアミンまたはジイソプロピルエチルアミン、およびN, O - ジメチルヒドロキシルアミン塩酸塩で、N, N - ジメチルホルムアミド中で処置することを含む、

プロセス。

【請求項 10】

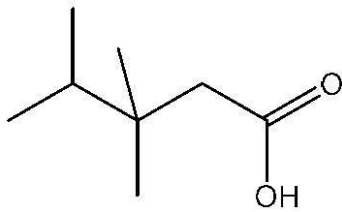
以下：

【化10-1】



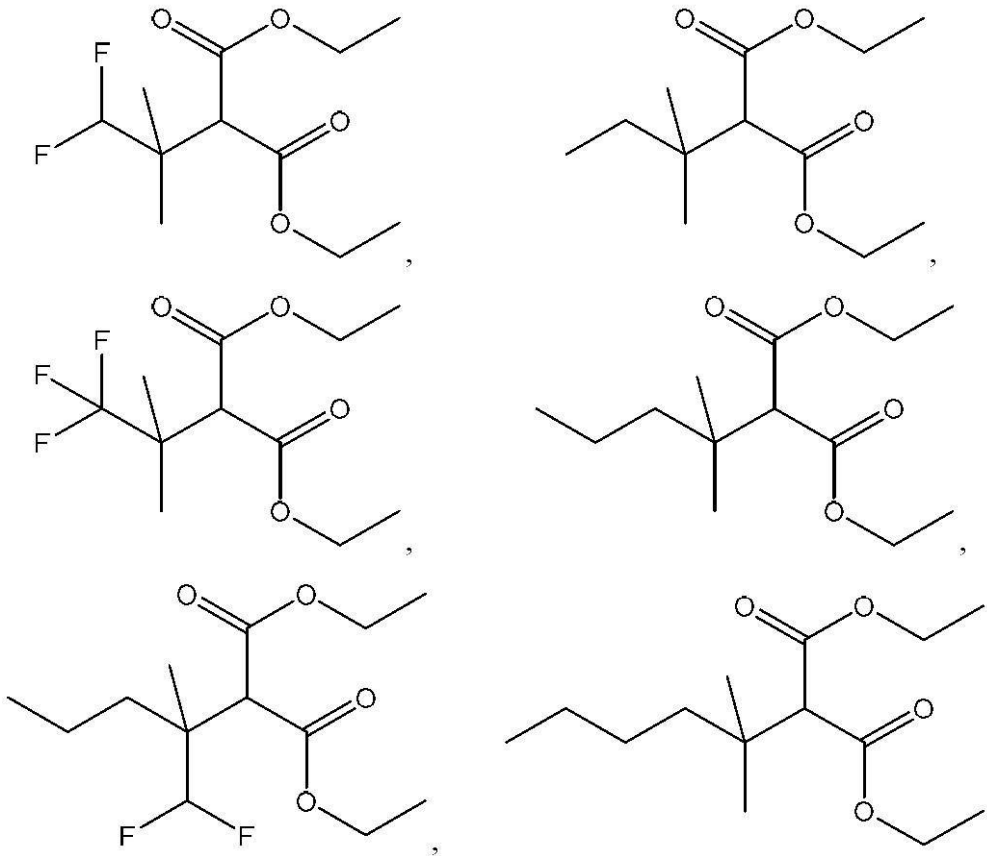
および

【化10-2】



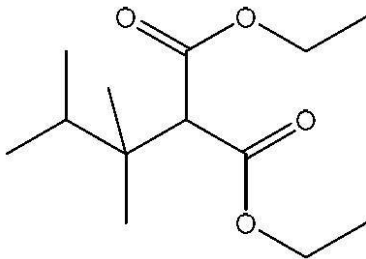
から選択される化合物を調製するための請求項9に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化10-3】



および

【化10-4】



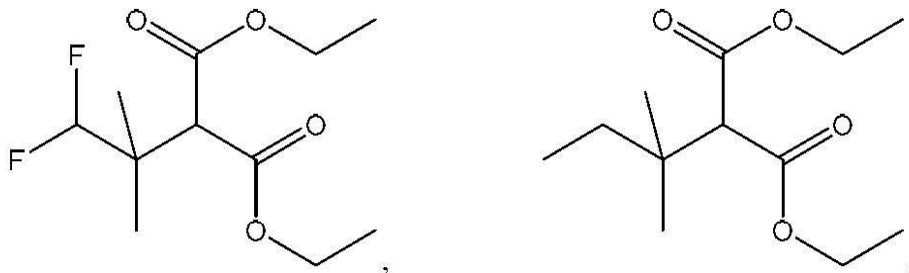
から選択される化合物を、水素化リチウムで、ジメチルスルホキシド水溶液中で処置することを含む、

プロセス。

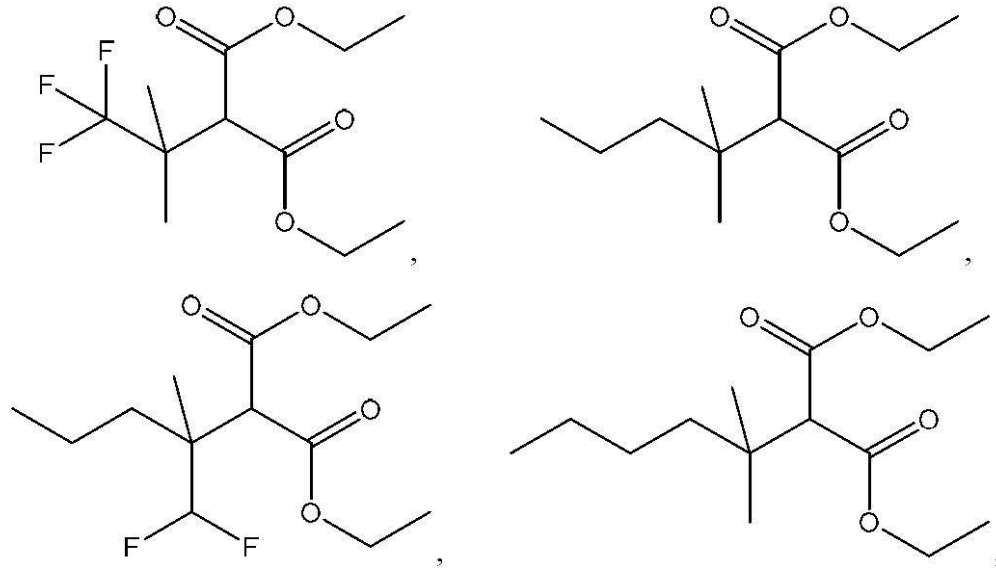
【請求項11】

以下：

【化11-1】

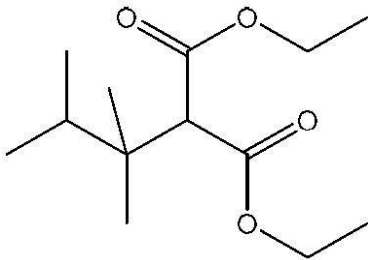


【化 1 1 - 2】



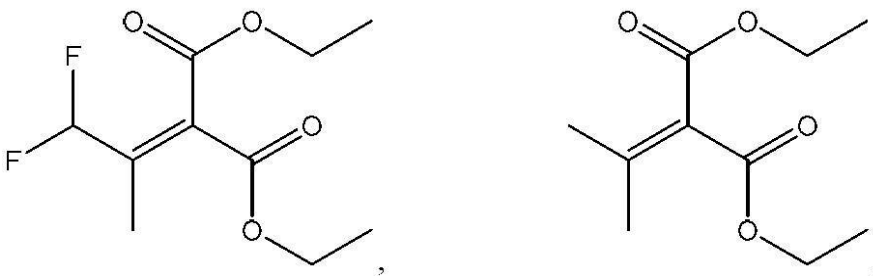
および

【化 1 1 - 3】



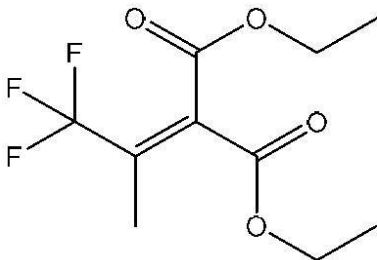
から選択される化合物を調製するための請求項 1 0 に記載のプロセスであって、
前記プロセスは、以下：

【化 1 1 - 4】



および

【化 1 1 - 5】



から選択される化合物を、ヨウ化メチルマグネシウム、臭化エチルマグネシウム、臭化 n - プロピルマグネシウム、臭化イソプロピルマグネシウム、または臭化 n - ブチルマグネシウム、およびヨウ化銅で、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、またはジクロロメタンおよびテトラヒドロフラン中で処置することを含む、
プロセス。